

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-307994

(43)公開日 平成 6 年(1994)11月 4 日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 1 N 1/00	1 0 1 G	7519-2 J		
	N	7519-2 J		
1/10	P	7519-2 J		
33/20	E	7906-2 J		

審査請求 有 請求項の数 2 F D (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平5-81134  
(22)出願日 平成 5 年(1993) 3 月17日

(71)出願人 000183303  
住友金属鉱山株式会社  
東京都港区新橋 5 丁目11番 3 号  
(72)発明者 藤田 哲也  
愛媛県新居浜市前田町18- 6

(54)【発明の名称】 高濃度液希釈装置及びそれを用いた高濃度液自動サンプリング装置

(57)【要約】

【目的】 金属イオン濃度が高く、結晶が析出しやすい液を希釈する為の装置とそれを用いたサンプリング装置を提案する。

【構成】 1 個の密閉容器中に計量する機構と、これから送液された液と希釈液とを 1 個の密閉容器中で希釈しこれを圧縮気体により遠隔の測定装置まで送液する構成である。

